

Q. Metrology, Inspection, and Yield Enhancement 분과

Room A
창의관 (106)

일 시 : 2월 17일(금) 15:30-16:45

세션명 : [FA4-Q] Q III

좌 장 : 박병천(한국표준과학연구원), 양준모(나노종합팹센터)

-
- FA4-Q-1 15:30-16:00 **[Invited]** Non-Visual Defect Inspection (Residues and Charge) for Advanced Process Control and Yield Engineering
저자: Sungjin Cho
소속: Qcept Technologies Inc.
- FA4-Q-2 16:00-16:15 Transmission Electron Microscopy Study on the Microstructural Properties of CoFeB/MgO/CoFeB Magnetic Tunnel Junctions
저자: 전승준¹, 손성규¹, 오장원¹, 유종희¹, 이주희¹, 김국천², 김원¹, 김호정¹, 김창열¹
소속: ¹하이닉스 반도체 분석개발팀, ²하이닉스 반도체 NM공정S팀
- FA4-Q-3 16:15-16:30 고속 검사를 위한 초소형전자칼럼 광학구조 연구
저자: 이영복¹, 오태식¹, 김대욱¹, 안승준¹, 최상국², 진상원², 김영철³, 김호섭¹
소속: ¹선문대학교 정보디스플레이학과, ²씨이비티(주), ³을지대학교
- FA4-Q-4 16:30-16:45 FIB 기법을 이용한 LED-TEM 시편의 정밀제작
저자: 박경진, 유정호, 곽상희, 박중식, 양준모
소속: 나노종합팹센터 특성평가팀